

19a-P8-6

## 結合量子井戸のX線反射率測定による構造評価

X-ray reflectivity measurements of coupled double quantum wells

産業技術総合研究所<sup>1</sup> ○牛頭 信一郎<sup>1</sup>, 物集照夫<sup>1</sup>, 河島 整<sup>1</sup>

AIST<sup>1</sup> ○Shin-ichiro Gozu<sup>1</sup>, Teruo Mozume<sup>1</sup>, Hitoshi Kawashima<sup>1</sup>

E-mail: s-gozu@aist.go.jp

我々は今までに分子線エピタキシ(MBE)法で成長したInP基板上InGaAs/AlAsSb材料系結合量子井戸で通信波長帯動作をするサブバンド間遷移超高速全光スイッチの研究を行ってきた[1]。通信波長帯光( $= 1.55 \mu\text{m}$ )はエネルギーに換算すると0.8eVにも達するため、結合量子井戸の各層は2-3nmから数分子層の薄さで正確に形成する必要がある。しかし、実際にMBE成長を行うと設計通り正確には形成されていない。本来なら禁制な遷移が光吸収測定において観測されるのがその理由である[2]。その原因の一つとして、シャッタートランジエント(ST)[3]による影響が考えられる。STはセル内の温度勾配が起源で、シャッター開閉で原料表面温度が変化する事が具体的な原因である。この影響を評価するために、我々は超格子サンプルの成長とX線回折測定によってInGaAsの時間依存成長レートの評価を行った[4]。その結果、成長初期は成長速度が遅く、時間と共に成長速度が一定の値に上昇する成長時間依存成長レートの評価に成功した。しかし、超格子サンプルを使用しているため全体の平均値しか評価出来ず、真の意味で過度現象を評価できたわけではない。これは、X線回折測定による膜厚測定に周期構造が必要である事に起因している。そこで今回は、周期構造を必要としないX線反射率測定によって評価を行い、STの考察を行ったので報告する。サンプルは単一結合量子井戸構造とし、成長条件が異なる2種類(CDQW(1),(2))をMBE成長で作製した(図1)。

InP 10nm cap by In (2)
InGaAs 30sec by In (1)
AlAs 3.7sec
InGaAs 30sec by In (1)
InP 50nm buff. by In (1) or In (2)
InP sub.

図1 作製した結合量子井戸、成長膜厚(時間)と使用したInセル

この2種類のサンプル間で結合量子井戸構造の違いはないが、2本のInセルを交互に使用してInPバッファ層の成長を行った。具体的にはCDQW(1): $\text{In}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{As}$ 成長で使用するIn(1)、CDQW(2): $\text{In}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{As}$ 成長では使用しないもう一つのIn(2)でInPバッファ層の成長を行った。この違いはCDQW(2)において、 $\text{In}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{As}$ 成長時に初めてIn(1)のシャッターが開く状況にするためである。X線反射率測定は表面酸化膜の影響等で最表面層の評価が難しい。従ってInP cap層の厚さは正確性に欠ける。一方 $\text{In}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{As}$ の膜厚はサンプルによって、また上下2層の間で異なっている(表1)。

表1 X線反射率測定結果より求められた各層の厚さ(nm)

層	CDQW(1)	CDQW(2)
InP cap. 10nm	10.8	11.1
$\text{In}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{As}$ 30 sec	2.90	2.73
AlAs 3.7 sec	0.41	0.41
$\text{In}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{As}$ 30 sec	3.18	3.35
InP buff. +sub.	N/A	N/A

また、傾向として $\text{In}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{As}$ 成長前にセルシャッターが閉じている時間が長いほどその後の $\text{In}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{As}$ 層が厚くなっている。従って、シャッターが閉じている時間に応じて原料表面温度が上昇し、シャッターが開いた後、過度的に多量の原料を供給している事がわかる。この結果は以前の結果[4]と一見矛盾している。しかし、今回の検討は真に成長初期を評価したためであると考えている。

- [1] 秋本, 物集, 石川, 応用物理, **79**(2010)0225.
- [2] 牛頭, 物集, 石川, 第58回応用物理学関係連合講演会 26a-BN-7
- [3] J. N. Miller, JVST B, **10**(1992)803., T. Roch *et. al.*, CEJP, **5**(2007)244.
- [4] 牛頭, 物集, 石川, 第72回応用物理学会学術講演会 31a-ZA-4